光応用・視覚研究会

〔委 員 長〕高橋信一（慶応義塾大学）
〔幹　　事〕篠田之孝（日本大学）、本田久司（東芝ライテック）

日　時　平成１８年3月3日（金）１３：００～１７：２０

場　所　電気学会第１～３会議室　(東京都千代田区五番町６－２　HOMAT　HORIZON ビル８F、JR 中央線、営団地下鉄有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線、いずれも市ヶ谷駅より徒歩３分、Tel 03-3221-7201）

協　賛　リソグラフィ先端技術調査専門委員会（委員長　堀内敏行、幹事　高橋信一、東　司）

議　題　テーマ「液浸リソグラフィ技術と EUV リソグラフィ技術」

13:00-15:00

LAV-06-1　Low k1 リソグラフィ
笠間邦彦（NEC エレクトロニクス）

LAV-06-2　ArF 液浸露光装置の開発状況
小林正道（キヤノン）

LAV-06-3　液浸リソグラフィ
龜山雅臣（ニコン）

LAV-06-4　高屈折率液浸材料開発
稗田克彦（JSR）

15:15-16:45

LAV-06-5　EUV 露光装置技術の開発の現状
福田惠明（EUVA）

LAV-06-6　低分子 EUV レジストの開発
塩野大寿（東京応化工業）

LAV-06-7　EUV 多層膜用キャッピングレイヤの開発
松成秀一（ニコン）

◎ 講演時間　1 件当り 30 分（質疑応答 5 分を含む）